(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出題

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年1月6日(06.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/001169 A1

(51) 国際特許分類7:

C30B 15/20, 29/06

PCT/JP2004/007252

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2004年5月27日(27.05.2004)

(25) 国際出願の登話:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特麗2003-184838 2003年6月27日(27.06.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越 半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目4番 2号 Tokyo (JP).

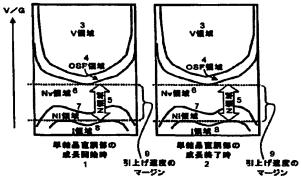
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米園についてのみ): 三田村 仲晃 (MITAMURA, Nobuaki) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西 白河郡西郷村大字小田倉字大平 1 5 0番地 信趙半導 体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 太田 友彦 (OHTA, Tomohiko) [JP/JP]; 〒3790125 群馬県安 中市中野谷字松原507 個越半導体株式会社 横野 平工場内 Gunma (JP). 布施川 泉 (FUSEGAWA, Izumi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田 倉字大平 1 5 0 番地 個越半導体株式会社 半導体白 河研究所内 Pukushima (JP). 楼田 昌弘 (SAKURADA, Masahiro) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村 大字小田倉字大平150番地信館半導体株式会社半 導体白河研究所內 Fukushima (JP). 尾崎 篤志 (OZAKI, Atsushi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大

[铁葉有]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SINGLE CRYSTAL AND SINGLE CRYSTAL

(54) 発明の名称: 単純品の製造方法及び単結晶



- 1...STRAIGHT TRUNK PORTION OF SINGLE CRYSTAL AT START OF GROWTH
- 2...STRAIGHT TRUNK PORTION OF SINGLE CRYSTAL AT END OF GROWTH
- 3...V REGION
- 4...OSF REGION
- 5...N REGION
- 6 NV REGION
- 7...Ni REGION
- 8...I REGION
- 9...MARGIN OF PULL-UP RATE

(57) Abstract: A method for producing a single crystal having a whole face in the radius direction being free of a defect through the pull-up of the single crystal from a melt of a raw material in a chamber by the Czochralsky Method, characterized in that conditions for the pull-up in the growth direction are changed so that the margin of the pull-up rate allowing the formation of a whole face in the radius direction free of a defect takes a specific value or more. The method can be employed for stably producing a single crystal baving a whole face in the radius direction being free of a defect, over the whole region in the direction of the growth axis of the crystal, in the growth of a single crystal by the CZ method.

(57) 要約: 本発明は、チョクラルスキー法によりチャンパ内で単結晶を原料融液から引上げて径方向の全面が無 欠陥領域となる単結晶を製造する方法において、前記単結晶をその径方向の全面が無欠陥領域となるように引上げ ることのできる引上げ速度のマージンが常に所定

[铙葉有]